

Doc. No.: NR070404

2007年4月4日

最先端の半導体製造プロセスを担う開発拠点「プロセス技術センター」を建設 ～プロセス開発機能を統合、世界トップシェアの洗浄装置技術をさらに強化～

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：垣内 永次)はこのほど、当社彦根地区事業所(滋賀県彦根市高宮町480-1)の敷地内に、半導体製造プロセスの新たな開発拠点「プロセス技術センター」を建設することを決定。2008年4月の稼働に向け、今月着工します。

デジタル家電の安定した成長や新興国の市場拡大などを背景に、半導体業界では今後も活況が続くと予想され、半導体デバイスメーカーでは技術開発や生産設備の強化が進められています。また、製造装置メーカーには、従来デバイスメーカーが多くを担っていたプロセス技術の領域についても、装置開発によって培われた技術力を応用展開することが期待されており、業界における役割が年々大きくなっています。このため、各製造装置メーカーには装置開発に加え、評価・解析など半導体プロセスの開発環境の充実が求められており、顧客の要望と信頼に応えるプロセス開発拠点が不可欠となっています。

今回着工する「プロセス技術センター」は、このような業界の動向にいち早く応えるもので、半導体製造におけるプロセス技術の開発機能を統合し、評価・分析など微細化が進む最先端デバイスのプロセス開発に対応できる施設として建設されます。プロセス開発や装置開発を行う専用のクリーンルームと実験装置を備えるとともに、現在洛西、野洲、多賀の各工場プロセス開発に携わる技術者約350人が集結。デバイスメーカーからの依頼によるプロセスデモンストレーションや、次世代プロセスの確立に向けた評価・解析など、ユニット単位での小規模なプロセス評価から300ミリウエハーの連続処理に至るまで、幅広い研究開発が同一施設内で可能となり、先進のプロセス開発のさらなる効率化・迅速化を実現します。また、同センターは当社半導体洗浄装置の製造拠点「Fab.FC-1、FC-2」に隣接しており、評価・分析により確立したプロセス技術を迅速に製造技術へとフィードバックできるため、生産装置に対する先進技術のタイムリーな導入を実現します。

当社は現在、世界トップシェアを誇る300ミリウエハー対応洗浄装置などへの高い信頼により、順調な受注と安定した装置の提供を続けており、半導体製造技術の変化と顧客の多彩なニーズに対応しています。今回の「プロセス技術センター」の建設により、他社の追随を許さないプロセス技術の創造と品質の向上を図り、さらなる市場競争力の強化とシェアの拡大を目指します。



☆ この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、
下記URLよりダウンロードできます。
(www.screen.co.jp/press/nr-photo/)

プロセス技術センター 完成イメージ

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目

<プロセス技術センターの概要>

名 称：彦根地区事業所「プロセス技術センター」
所 在 地：滋賀県彦根市高宮町480-1
敷 地 面 積：約6,600平方メートル
(彦根地区事業所の総敷地面積は約14万4,300平方メートル)
建 築 面 積：約3,900平方メートル
延 床 面 積：約1万1,200平方メートル
構 造：鉄筋コンクリート造3階建
総 工 費：約80億円
着 工：2007年4月
稼働開始予定：2008年4月
主 な 用 途：半導体製造プロセスの研究・開発